(12) 公 開 特 許 公 報(A)

(19) 日本国特許庁(JP)

(11)特許出願公開番号
特開2005-80839
(P2005-80839A)
(43)公開日 平成17年3月31日(2005.3.31)

(51) Int.C1. ⁷		FI			テーマコード	(参考)
A61B	6/03	A 6 1 B	6/03	350F	2G088	
GO 1T	1/00	A 6 1 B	6/03	320Y	40093	
GO 1T	1/1 6 1	GO1T	1/00	В	5 C O 2 4	
HO4N	5/32	GO1T	1/161	С		
		HO4N	5/32			
			審査	請求 有	請求項の数 16 OL	(全 18 頁)
(21) 出願番号		特願2003-315505 (P2003-315505)	(71) 出願人	. 300019	9238	
(22) 出願日		平成15年9月8日 (2003.9.8)		ジーイ	ー・メディカル・シスラ	トムズ・グロ
				ーバル	/・テクノロジー・カン ノ	ペニー・エル
				エルシ	/ 	
				アメリ	カ合衆国・ウィスコンシ	/ン州・53
				188	・ワウケシャ・ノース・	グランドヴ
				고 — ·	ブールバード・ダブリコ	$-\cdot 710$
				• 3 C	000	
			(74) 代理人	. 100094	4053	
				弁理士	: 佐藤 隆久	
			(72)発明者	鄉野	誠	
				東京都	『日野市旭が丘四丁目7番	静地の127
				ジー	-イー横河メディカルシク	マテム株式会
				社内		
					最終	8頁に続く

(54) 【発明の名称】放射線断層撮影装置およびその放射線断層撮影方法

(57)【要約】

【課題】クロストークによる断層画像のコントラストの 低下やアーチファクトの発生を防止し、断層画像の画像 品質を向上する。

【解決手段】互いが隣接して配置されている複数のX線 検出モジュール23A,23Bにおいてアレイ状に配置 されているX線検出素子によって検出されるX線により 生成される検出データのうち、複数のX線検出モジュー ル23A,23Bの境界Kに隣接するX線検出素子が検 出するX線による第1検出データA41が、その周囲の X線検出素子が検出するX線による第2検出データA1 1,A21,A31,B21,B31,B41に基づく 波形データと適合するようにして、検出データをフィッ ティング処理する。

【選択図】図6

(a)								2
A11	A21	A31	A41	B11	B21	B31	B41	
A12	A22	A32	A42	B12	B22	B32	B42	
A13	A23	A33	A43	B13	B23	B33	B43	×
A14	A24	A34	A44	B14	B24	B34	B44	¥
A15	A25	A35	A45	B15	B25	B35	B45	
A16	A26	A36	A46	B16	B26	B36	B46	
A17	A27	A37	A47	B17	B27	B37	B47	
A18	A28	A38	A48	B18	B28	B38	B48	
A1	A 2	A3	A4 /	в1	B2	B3	B4	
	23	A			2	зв		

	23	A			2	3B	
Al	A 2	A3	A4	B1	B2	B 3	B4
A18	A28	A38	A'48	B'18	B28	B38	B48
A17	A27	A37	A' 47	B'17	B27	B37	B47
A16	A26	A36	A'46	B'16	B26	B36	B46
A15	A25	A35	A'45	B'15	B25	B35	B45
A14	A24	A34	A'44	B'14	B24	B34	B44
A13	A23	A33	A'43	B'13	B23	B33	B43
A12	A22	A32	A'42	B'12	B22	B32	B42
A11	A21	A31	A'41	B'11	B21	B31	B43
(Ь)							

【特許請求の範囲】

【請求項1】

被撮影体の撮影領域に放射線を照射する放射線照射手段と、

前記被撮影体の撮影領域を透過する前記放射線を検出する放射線検出素子がアレイ状に 配置されている第1および第2の放射線検出モジュールを有しており、前記第1および第 2の放射線検出モジュールが互いに隣接して配置されている放射線検出手段と、

前記放射線検出手段が検出する放射線により生成される検出データのうち、前記第1お よび第2の放射線検出モジュールの境界に隣接する前記放射線検出素子である第1放射線 検出素子が検出する放射線により生成される第1検出データが、前記第1放射線検出素子 の周囲の前記放射線検出素子である第2放射線検出素子が検出する放射線により生成され 10 る第2検出データに基づく波形データと適合するようにして、前記検出データをフィッテ ィング処理するフィッティング処理手段と

を有する放射線断層撮影装置。

【請求項2】

前記フィッティング処理手段は、前記第1検出データと前記第2検出データとを用いて フィッティング処理をする

請求項1に記載の放射線断層撮影装置。

【請求項3】

前記フィッティング処理手段は、前記第2検出データのみを用いるフィッティング処理 により前記第1検出データに対応するダミーデータを算出し、前記ダミーデータを前記第 20

1 検出データと置換する

請求項1に記載の放射線断層撮影装置。

【請求項4】

前記フィッティング処理手段は、前記第2検出データを用いるフィッティング処理によ り前記第1検出データに対応する第1ダミーデータを前記第1および第2の放射線検出モ ジュールのそれぞれで算出し、前記第1ダミーデータと前記第1検出データとの差分デー タを第1および第2の放射線検出モジュールのそれぞれで算出し、前記差分データの平均 値データを前記第1および第2の放射線検出モジュールのそれぞれで算出し、前記第1デ ータと前記差分平均値データとの差分である第2ダミーデータを前記第1および第2の放 射線検出モジュールのそれぞれで算出し、前記第1および第2の放射線検出モジュールの それぞれに対応する前記第1検出データを前記第2ダミーデータに置換する

請求項1に記載の放射線断層撮影装置。

【請求項5】

前記フィッティング処理手段は、前記フィッティング処理として多項式フィッティング 処理を行う

請求項1から4のいずれかに記載の放射線断層撮影装置。

【請求項6】

前 記 フィッティング処理された 検出 データに 基 づ い て 前 記 被 撮 影 体 の 撮 影 領 域 の 断 層 画 像 データを 生 成 す る 断 層 画 像 生 成 手 段 を 有 す る

請求項1から5のいずれかに記載の放射線断層撮影装置。

【請求項7】

前 記 断 層 画 像 生 成 手 段 が 生 成 す る 前 記 断 層 画 像 デ ー タ に 基 づ い て 断 層 画 像 を 表 示 す る 表

示手段を有する

請求項6に記載の放射線断層撮影装置。

【請求項8】

前記放射線照射手段は、前記放射線としてX線を照射する

請 求 項 1 から 7 の い ず れ か に 記 載 の 放 射 線 断 層 撮 影 装 置 。

【請求項9】

被撮影体の撮影領域に放射線を照射する放射線照射手段と、前記被撮影体の撮影領域を 透過する前記放射線を検出する放射線検出素子がアレイ状に配置されている第1および第 5

50

30

10

20

30

40

2の放射線検出モジュールを有しており、前記第1および第2の放射線検出モジュールが 互いに隣接して配置されている放射線検出手段とを有する放射線断層撮影装置を用いる放 射線断層撮影方法であって、 前 記 放 射 線 検 出 手 段 が 検 出 す る 放 射 線 に よ り 生 成 さ れ る 検 出 デ ー タ の う ち 、 前 記 第 1 お よび 第 2 の 放 射 線 検 出 モ ジ ュ ー ル の 境 界 に 隣 接 す る 前 記 放 射 線 検 出 素 子 で あ る 第 1 放 射 線 検 出 素 子 が 検 出 す る 放 射 線 に よ り 生 成 さ れ る 第 1 検 出 デ ー タ が 、 前 記 第 1 放 射 線 検 出 素 子 の周囲の前記放射線検出素子である第2放射線検出素子が検出する放射線により生成され る第2検出データに基づく波形データと適合するようにして、前記検出データをフィッテ ィング処理するフィッティング処理工程 を有する放射線断層撮影方法。 【請求項10】 前記フィッティング処理工程においては、 前記第1検出データと前記第2検出データとを用いるフィッティング処理をする 請求項9に記載の放射線断層撮影方法。 【請求項11】 前記フィッティング処理工程においては、 前 記 第 2 検 出 デ ー タ を 用 い る フィ ッ ティ ン グ 処 理 に よ り 前 記 第 1 検 出 デ ー タ に 対 応 す る ダミーデータを算出し、 前記ダミーデータを前記第1検出データと置換する 請求項9に記載の放射線断層撮影方法。 【請求項12】 前記フィッティング処理工程においては、 前 記 第 2 検 出 デ ー タを 用 い る フィ ッ ティ ン グ 処 理 に よ り 前 記 第 1 検 出 デ ー タ に 対 応 す る 第 1 ダミーデータを前記第 1 および第 2 の放射線検出モジュールのそれぞれで算出し、 前 記 第 1 ダ ミ ー デ ー タ と 前 記 第 1 検 出 デ ー タ と の 差 分 デ ー タ を 第 1 お よ び 第 2 の 放 射 線 検 出 モ ジ ュ ー ル の そ れ ぞ れ で 算 出 し 、 前 記 差 分 デ ー タ の 平 均 値 デ ー タ を 前 記 第 1 お よ び 第 2の放射線検出モジュールのそれぞれで算出し、前記第1データと前記差分平均値データ と の 差 分 で あ る 第 2 ダ ミ ー デ ー タ を 前 記 第 1 お よ び 第 2 の 放 射 線 検 出 モ ジ ュ ー ル の そ れ ぞ れで 算 出 し 、 前 記 第 1 お よ び 第 2 の 放 射 線 検 出 モ ジュ ー ル の そ れ ぞ れ に 対 応 す る 前 記 第 1 検出データを前記第2ダミーデータに置換する 請求項9に記載の放射線断層撮影方法。 【請求項13】 前記フィッティング処理工程においては、 前記フィッティング処理として多項式フィッティング処理を行う 請求項9から12のいずれかに記載の放射線断層撮影方法。 【請求項14】 前 記 フィ ッティン グ 処 理 さ れ た 検 出 デ ー タ に 基 づ い て 断 層 画 像 デ ー タ を 生 成 す る 断 層 画 像生成工程を有する 請求項9から13のいずれかに記載の放射線断層撮影方法。 【請求項15】 前 記 断 層 画 像 生 成 工 程 に て 生 成 さ れ る 前 記 断 層 画 像 デ ー タ に 基 づ い て 断 層 画 像 を 表 示 す る表示工程を有する 請求項14に記載の放射線断層撮影方法。 【請求項16】 前記放射線としてX線を照射する 請求項9から15のいずれかに記載の放射線断層撮影方法。 【発明の詳細な説明】 【技術分野】

- - 本 発 明 は 、 放 射 線 断 層 撮 影 装 置 お よ び そ の 放 射 線 断 層 撮 影 方 法 に 関 す る も の で あ る 。 50

(3)

【背景技術】

[0002]

放射線断層撮影装置として、放射線であるX線を用いて被撮影体の断層面の画像を生成 するX線CT(Computed Tomography)装置が知られている。X線C T 装置は、人体や物体などを被撮影体とし、医療用途や産業用途などの広範な用途で利用 されている。

[0003]

X線CT装置は、被撮影体の体軸方向を軸として被撮影体の周囲を走査して、複数のビ ユー方向から被撮影体にX線をX線管から照射する。そして、X線管から照射されたX線 をコリメータにより遮って、被撮影体の撮影領域に照射するようにX線を成形する。そし て、コリメータを介して複数のビュー方向から被撮影体を透過するX線を、それぞれのビ ュー 方 向 ご と に X 線 検 出 ア レ イ で 検 出 し 、 X 線 検 出 ア レ イ の 検 出 し た X 線 に よ り 生 成 さ れ る 検 出 デ ー タ に 基 づ い て 被 撮 影 体 の 撮 影 領 域 の 断 層 像 を 再 構 成 し て 生 成 す る 。 [0004]

X 線 C T 装 置 は 、 被 撮 影 体 の 撮 影 部 位 や 撮 影 す る 目 的 が 多 様 化 し て き て お り 、 解 像 度 な どの画像品質の向上や撮影の高速化が要求されている。このような要求に応えるため、X 線 C T 装 置 は 、 被 撮 影 体 の 周 囲 を 一 回 転 走 査 す る 間 に 複 数 の 断 層 像 を 得 る こ と が で き る よ うに、 複数の X 線検出素子がアレイ状に配列された X 線検出アレイを有している。 X 線検 出 ア レ イ は 、 X 線 を 検 出 す る X 線 検 出 素 子 が ア レ イ 状 に 複 数 配 列 さ れ て い る X 線 検 出 モ ジ ュールを有しており、製造を容易とするために、複数のX線検出モジュールがチャネル方 向と体軸方向とのそれぞれに隣接して配置されて構成されている。 [0005]

複数の X 線検出素子がアレイ状に配列された X 線検出アレイにおいては、 複数の X 線検 出 素 子 が 互 い に 近 接 し て 配 置 さ れ て い る た め 、 検 出 し た X 線 に よ っ て X 線 検 出 素 子 間 で ク ロストークが発生する場合があった。このため、X線CT装置は、クロストークを含む検 出データに基づいて断層像を再構成して生成する場合に、断層画像のコントラストの低下 やアーチファクトが発生し、画像品質が劣化する場合があった。

[0006]

従来において、クロストークによる画像品質の劣化を防止するために、さまざまな方法 が提案されている。たとえば、従来においては、あらかじめ、それぞれのX線検出素子ご 30 とにクロストーク発生量を求めて、その求められたクロストーク発生量を用いて検出デー タの補正を実施している(たとえば、特許文献1参照)。

【 特 許 文 献 1 】 米 国 特 許 4 8 9 7 7 8 8 号 明 細 書

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

しかしながら、従来においては、体軸方向を軸としてファントムの周囲を走査するため チャネル方向のそれぞれのX線検出素子ごとにクロストーク発生量を求めることは容易 であったが、体軸方向でのクロストーク発生量を求めることが困難であった。このため、 従来においては、体軸方向でのクロストークによる画像品質の劣化を防止することが困難 であった。特に、 複数の X 線検出モジュールの体軸方向での境界には X 線検出素子間で切 れ 目 が あ る た め に 、 X 線 検 出 モ ジ ュ ー ル の 体 軸 方 向 で の 境 界 近 傍 に あ る X 線 検 出 素 子 と 、 その周囲のX線検出素子とでは、それぞれに近接するX線検出素子の数が異なり、クロス トーク発生量の体軸方向でのプロファイルが不連続となるため、断層画像のコントラスト の低下やアーチファクトの発生が顕著であった。

 $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 8 \end{bmatrix}$

また、従来においては、実際に検出データを得る際のクロストーク発生量でなく、あら かじめ求められたクロストーク発生量を用いるために、より高精度に補正することができ ず、画像品質を十分に向上させることができなかった。 [0009]

40

10

したがって、本発明の目的は、クロストークによる断層画像のコントラストの低下やア ーチファクトの発生を防止し、断層画像の画像品質を向上できる放射線断層撮影装置およ びその放射線断層画像撮影方法を提供することにある。

【課題を解決するための手段】

[0010]

上記目的を達成するため、本発明の放射線断層撮影装置は、被撮影体の撮影領域に放射線を照射する放射線照射手段と、前記被撮影体の撮影領域を透過する前記放射線を検出する放射線検出素子がアレイ状に配置されている第1および第2の放射線検出モジュールが互いに隣接して配置されている放射線検出手段と、前記放射線検出手段が検出する放射線により生成される検出データのうち、前記第1および第2の放射線検出モジュールの境界に隣接する前記放射線検出素子である第1放射線検出素子が検出する放射線により生成される第1検出データが、前記第1放射線検出素子の周囲の前記放射線検出素子である第2放射線検出素子が検出する放射線により生成される第2検出データに基づく波形データと適合するようにして、前記検出データをフィッティング処理するフィッティング処理手段とを有する。

以上の本発明の放射線撮影装置においては、被撮影体の撮影領域に放射線を照射し、互 いが隣接して配置されている第1および第2の放射線検出モジュールにおいてアレイ状に 配置されている放射線検出素子により、被撮影体の撮影領域を透過する放射線を検出する 。そして、放射線検出手段が検出する放射線により生成される検出データのうち、第1お よび第2の放射線検出モジュールの境界に隣接する放射線検出素子である第1放射線検出 素子が検出する放射線により生成される第1検出データが、第1放射線検出素子の周囲の 放射線検出素子である第2放射線検出素子が検出する放射線により生成される第2検出デ ータに基づく波形データと適合するようにして、検出データをフィッティング処理する。 【0012】

上記目的を達成するために、本発明の放射線断層撮影方法は、被撮影体の撮影領域に放 射線を照射する放射線照射手段と、前記被撮影体の撮影領域を透過する前記放射線を検出 する放射線検出素子がアレイ状に配置されている第1および第2の放射線検出モジュール を有しており、前記第1および第2の放射線検出モジュールが互いに隣接して配置されて いる放射線検出手段とを有する放射線断層撮影装置を用いる放射線断層撮影方法であって 、前記放射線検出手段が検出する放射線により生成される検出データのうち、前記第1お よび第2の放射線検出モジュールの境界に隣接する前記放射線検出素子である第1放射線 検出素子が検出する放射線により生成される第1検出データが、前記第1放射線検出素子 の周囲の前記放射線検出素子である第2放射線検出素子が検出する放射線により生成され る第2検出データに基づく波形データと適合するようにして、前記検出データをフィッテ ィング処理するフィッティング処理工程を有する。

【0013】

以上の本発明の放射線撮影方法においては、被撮影体の撮影領域に照射されて撮影領域 を透過し、互いが隣接して配置されている第1および第2の放射線検出モジュールにおい てアレイ状に配置されている放射線検出素子により検出される放射線により生成される検 出データのうち、第1および第2の放射線検出モジュールの境界に隣接する放射線検出素 子である第1放射線検出素子が検出する放射線により生成される第1検出データが、第1 放射線検出素子の周囲の前記放射線検出素子である第2放射線検出素子が検出する放射線 により生成される第2検出データに基づく波形データと適合するようにして、検出データ をフィッティング処理する。

【発明の効果】

[0014]

本発明によれば、クロストークによる断層画像のコントラストの低下やアーチファクト の発生を防止し、断層画像の画像品質を向上できる放射線断層撮影装置およびその放射線 断層画像撮影方法を提供することができる。 10

50

(6)

【発明を実施するための最良の形態】

[0015**]**

以下、図面を参照して本発明の実施の形態を詳細に説明する。

【0016】

< 実施形態1 >

図1は、本発明の実施形態1に係る放射線断層撮影装置としてのX線CT装置1の全体構成を示すブロック図であり、図2は、本発明の実施形態1に係る放射線断層撮影装置としてのX線CT装置1の要部を示す構成図である。

[0017**]**

図1に示すように、本実施形態のX線CT装置1は、走査ガントリ2と操作コンソール 10 3と撮影テーブル4とを有している。

【0018】

走査ガントリ2は、X線管20とX線管移動部21とコリメータ22とX線検出アレイ 23とデータ収集部24とX線コントローラ25とコリメータコントローラ26と回転部 27と回転コントローラ28とを主構成要素として有している。ここで、X線管20とX 線検出アレイ23とは、互いの間にあるX線照射空間29を挟んで対向している。

【0019】

なお、走査ガントリ2のうち、X線管20により本発明に係る放射線照射手段が構成され、X線検出アレイ23により本発明に係る放射線検出手段が構成され、回転部27により本発明に係る回転手段が構成される。

20

X線管20は、X線コントローラ25からの制御信号CTL251に基づいて、所定強度のX線5を、コリメータ22を介して被撮影体6の撮影領域に照射する。 【0021】

X線管移動部21は、X線コントローラ25からの制御信号CTL252に基づいて、 X線管20の放射中心を、走査ガントリ2におけるX線照射空間29内の撮影テーブル4 に載置される被撮影体6の体軸方向(図1の紙面に直交する方向、および、図2のz方向)に移動させる。

[0022]

コリメータ22は、X線管20とX線検出アレイ23との間に配置されており、コリメ 30 ータコントローラ26からの制御信号CTL261に基づいて、X線管20から放射され たX線5をチャネル方向×と体軸方向zとでそれぞれ遮り、チャネル方向×と体軸方向z とに所定幅を有するコーン状のX線5に成形してX線5の照射範囲を調整する。ここで、 X線5の照射範囲は、制御信号CTL261に基づいてコリメータ22のアパーチャの開 度を調節することにより設定される。コリメータ22のアパーチャの開度調節は、たとえ ば、チャネル方向×と体軸方向zとにそれぞれ設けられた2枚の板を独立して移動させる ことにより行われる。

[0023]

X線検出アレイ23は、複数のX線検出素子がアレイ状に配置されているX線検出モジュール23A,23B,23C,23D,23E,23F,23G,23Hを8つ有して 40 おり、8つのX線検出モジュール23A,23B,23C,23D,23E,23F,2 3G,23Hが、A列からH列の順に体軸方向zに隣接して並列し配置されている。 【0024】

なお、 X 線検出アレイ 2 3 のうち、 X 線検出モジュール 2 3 A , 2 3 B , 2 3 C , 2 3 D , 2 3 E , 2 3 F , 2 3 G , 2 3 H によって本発明に係る放射線検出モジュールが構成 され、 たとえば、 A 列と B 列との X 線検出モジュールが、 第 1 および第 2 の放射線検出モ ジュールに相当する。また、 X 線検出素子 2 3 a によって、本発明に係る放射線検出素子 が構成される。

【0025】

図 3 は、本実施形態における X 線検出アレイ 2 3 を構成する 8 つの X 線検出モジュール 50

23 A , 23 B , 23 C , 23 D , 23 E , 23 F , 23 G , 23 H のうち、 A 列の X 線 検出モジュール23Aを示す構成図である。図3に示すように、X線検出モジュール23 A は、 X 線検出素子 2 3 a がチャネル方向 x と体軸方向 z とにアレイ状に配列されている 。 2 次 元 的 に 配 列 さ れ た 複 数 の X 線 検 出 素 子 2 3 a は 、 全 体 と し て 、 円 筒 凹 面 状 に 湾 曲 し たX線入射面を形成する。ここで、チャネル方向×には、たとえば、1000個のX線検 出 素 子 2 3 a が 配 列 さ れ て お り 、 体 軸 方 向 z に は 、 た と え ば 、 8 個 の X 線 検 出 素 子 2 3 a が配列されている。なお、B列からH列のX線検出モジュール23B,23C,23D, 23E, 23F, 23G, 23Hも、図3に示すA列のX線検出モジュール23Aと同様 である。このため、 8 つの X 線検出モジュール 2 3 A , 2 3 B , 2 3 C , 2 3 D , 2 3 E ,23F,23G,23Hを有するX線検出アレイ23は、1モジュール当たり、たとえ ば、4個の検出データが生成されるものとする場合、合計で32個の検出データを生成す ることができる。

(7)

[0026]

X線検出素子23aは、たとえば、シンチレータ(scintillator)とフォ トダイオード(photo diode)の組み合わせによって構成されている。なお、 X線検出素子23aは、これに限定されるものではなく、たとえば、カドミウム・テルル (CdTe)等を利用した半導体 X 線検出素子、あるいはキセノン(Xe)ガスを利用し た電離箱型のX線検出素子23aであって良い。

本 実 施 形 態 に お い て は 、 複 数 の X 線 検 出 モ ジ ュ ー ル 2 3 A , 2 3 B , 2 3 C , 2 3 D , 20 23 E , 23 F , 23 G , 23 H の境界に隣接する X 線検出素子 23 a で検出される X 線 のローデータにより、第1検出データが生成され、第1検出データとなるローデータを得 た X 線 検 出 素 子 2 3 a の 周 囲 に あ る X 線 検 出 素 子 2 3 a に よ り 検 出 さ れ た X 線 の ロ ー デ ー タにより、第2検出データが生成される。たとえば、AとBとのX線検出モジュール23 A , 2 3 B のそれぞれにおいては、 A と B との X 線検出モジュール 2 3 A , 2 3 B の境界 に 最 も 近 い 位 置 に あ る 1 つ の X 線 検 出 素 子 2 3 a に よ り 第 1 検 出 デ ー タ を 得 る 。 ま た 、 第 1 検出 データを得るための X 線検出 素子 2 3 a に 体 軸 方 向 で 近 接 す る 3 つの X 線 検出 素子 2 3 a を 用 N て 第 2 検 出 デ ー 夕 を 得 る 。 複 数 の X 線 検 出 モ ジ ュ ー ル 2 3 A , 2 3 B , 2 3 C , 2 3 D , 2 3 E , 2 3 F , 2 3 G , 2 3 H の体軸方向 z での境界にはX 線検出素子 2 3 a 間 で 切 れ 目 が あ り 、 X 線 検 出 モ ジュ ー ル 2 3 A , 2 3 B , 2 3 C , 2 3 D , 2 3 E , 23 F , 23 G , 23 H の 体 軸 方 向 z で の 境 界 近 傍 に あ る X 線 検 出 素 子 23 a と 、 そ の 周 囲の X 線検出素子 2 3 a とでは、それぞれに近接する X 線検出素子 2 3 a の数が異なるた めに、クロストーク発生量の体軸方向でのプロファイルが不連続となる。このため、第1 検出データは、第2検出データと異なるクロストーク発生量を含む。 [0028]

なお、 X 線検出素子 2 3 のうち、 複数の X 線検出モジュール 2 3 A , 2 3 B , 2 3 C , 2 3 D , 2 3 E , 2 3 F , 2 3 G , 2 3 H の境界に隣接して第 1 検出データとなる X 線を 検 出 す る X 線 検 出 素 子 2 3 a に よ っ て 、 本 発 明 に 係 る 第 1 放 射 線 検 出 素 子 が 構 成 さ れ る 。 また、 第 1 検出 デ ー タとなる X 線を検出 する X 線検出 素子 2 3 a の 周 囲 に ある X 線検出 素 子 2 3 a によって、本 発 明 に 係 る 第 2 放 射 線 検 出 素 子 が 構 成 さ れ る 。 [0029]

図 4 , 図 5 は、 X 線 管 2 0 とコリメータ 2 2 と X 線検出 アレイ 2 3 の相互関係を示す図 である。図4において、図4(a)は体軸方向zを視線とした側から見た状態を示す図で あり、図4(b)はチャネル方向×を視線として側から見た状態を示す図である。また、 図 5 は、図 4 (b) と同様にチャネル方向 x を視線として側から見た状態において、被撮 影体 6 を撮影する様子を示す図である。

図 4 (a) , 図 4 (b) に示すように、 X 線管 2 0 から放射された X 線 5 は、コリメー 夕 2 2 によって所定のコーン角を有するコーン状の X 線 5 となるように成形され、 X 線検 出アレイ23の所定領域に照射されるようになっている。そして、図5に示すように、被

10

撮影体 6 を 撮 影 す る 場 合 に お い て は 、 撮 影 テ ー ブ ル 4 に 載 置 さ れ た 被 撮 影 体 6 が X 線 照 射 空間29に搬入され、被撮影体6の体軸方向を軸として被撮影体6の周囲を走査して、被 撮影体 6 の 撮影 領 域 に X 線 管 2 0 か ら X 線 5 が 照 射 さ れ る 。 そ し て 、 X 線 管 2 0 か ら 照 射 された X 線 5 は、コリメータ 2 2 を介して被撮影体 6 を透過して X 線検出アレイ 2 3 に検 出される。

(8)

 $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 3 & 1 \end{bmatrix}$

データ収集部24は、X線検出アレイ23の個々のX線検出素子23aによるローデー 夕を収集し、操作コンソール3に出力する。図2に示すように、データ収集部24は、た とえば、 選択 ・ 加算 切 換 回 路 (M U X , A D D) 2 4 1 とアナログ - デジタル 変 換 器 (A D C 2 4 2 とを有する。選択・加算切換回路 2 4 1 は、 X 線検出アレイ 2 3 の X 線検出素 子 2 3 a によるローデータを、操作コンソール 3 の中央処理装置 3 0 からの制御信号 C T L303に応じて選択し、あるいは組み合わせを変えて足し合わせ、その結果をアナログ - デジタル変換器242に出力する。アナログ - デジタル変換器242は、選択・加算切 換回路241において選択あるいは任意の組み合わせで足し合わされたローデータをアナ ログ信号からデジタル信号に変換して、操作コンソール3の中央処理装置30に出力する

[0032]

X 線 コントローラ 2 5 は、操作 コンソール 3 の中央処理装置 3 0 からの制 御信号 C T L 3 0 1 に応じて、 X 線 管 2 0 に対し制 御 信 号 C T L 2 5 1 を出力して X 線 放射の制 御を行 う。また、 X 線コントローラ 2 5 は、操作コンソール 3 の中央処理装置 3 0 による制御信 20 号CTL301に応じて、X線管移動部221に対し制御信号CTL252を出力して、 X線管20の放射中心を体軸方向zに指示に応じた距離だけ移動させる。

[0033]

コリメータコントローラ26は、操作コンソール3の中央処理装置30による制御信号 CTL302に応じて、コリメータ22に対して制御信号CTL261を出力しコリメー 夕 2 2 の ア パ ー チ ャ 2 2 1 の 開 度 を 調 整 し て 、 X 線 管 2 0 か ら 放 射 さ れ た X 線 5 を 成 形 さ せて X 線検出アレイ 2 3 の所望の領域に照射させる。

[0034]

回 転 部 2 7 は、回 転 コン トローラ 2 8 による制 御 信 号 C T L 2 8 に 基 づ い て 所 定 の 方 向 に回転する。この回転部27には、X線管20とX線管移動部21とコリメータ22とX 30 線検出アレイ23とデータ収集部24とX線コントローラ25とコリメータコントローラ 2 6 とが 搭載 されており、これらの 構成 要素 は、 回 転 部 2 7 の 回 転 に 伴 って X 線 照 射 空 間 29に搬入される被撮影体 6 に対して位置関係が変化する。回転部 27 を回転させること により、 被 撮 影 体 6 の 体 軸 方 向 を 軸 と し 複 数 の ビ ュ ー 方 向 か ら X 線 5 を 照 射 し て 、 被 撮 影 体 6 を透過した X 線 5 を検出する。

[0035]

回転コントローラ28は、操作コンソール3の中央処理装置30による制御信号CTL 3 0 4 に応じて、回転部 2 7 に対し制御信号 C T L 2 8 を出力して、所定の方向に所望の 回転数だけ回転させる。

[0036]

操 作 コンソール 3 は、 中 央 処 理 装 置 3 0 と入力 装 置 3 1 と 表 示 装 置 3 2 と 記 憶 装 置 3 3

とを主構成要素として有している。

[0037]なお、ここで、中央処理装置30は、本発明に係るフィッティング処理手段と断層画像 生成手段とを含む。また、表示装置32により本発明に係る表示手段が構成される。 [0038]

中央処理装置30は、たとえば、マイクロコンピュータ等により構成され、各種の機能 に応じたプログラムを有する。中央処理装置30は、入力装置31から入力される指示に 応 じ て 、 被 撮 影 体 6 が 載 置 さ れ る 撮 影 テ ー ブ ル 4 を 走 査 ガ ン ト リ 2 の X 線 照 射 空 間 2 9 に 対して搬入または搬出させるために、制御信号CTL30bを撮影テーブル4に出力する 10

20

30

40

【 0 0 3 9 】

そして、中央処理装置30は、入力装置31から入力されるマルチスライススキャンの 開始指示を受けて走査ガントリ2の回転コントローラ28に制御信号CTL304を出力 して、走査ガントリ2の回転部27を所定方向に指示に応じた回数に回転させる。 【0040】

また、中央処理装置30は、走査ガントリ2のX線管20にX線5の放射させるために、制御信号CTL301をX線コントローラ25に出力する。 【0041】

そして、中央処理装置30は、入力装置31から入力される被撮影体6の撮影領域の情 10 報を受けて、制御信号CTL301をX線コントローラ25に出力し、X線管20の放射 中心を体軸方向zへ指示に応じた距離だけ移動させる。また、その際には、X線5を所定 範囲に放射させるために、所定のアパーチャ開度となるようにコリメータ22を制御する 制御信号CTL302を、コリメータコントローラ26に出力する。 【0042】

そして、中央処理装置30は、入力装置31から入力される被撮影体6の撮影領域の情報に応じて、X線検出アレイ23のX線検出素子23aが得るローデータを選択、あるいは、組み合わせを変えて足し合わせるように、制御信号CTL303をデータ収集部24の選択・加算切換回路241に出力する。また、中央処理装置30は、データ収集部24が収集したローデータに、感度補正などの前処理を施して、検出データを生成する。 【0043】

そして、中央処理装置30は、フィッティング処理手段として機能するプログラムを有し、フィッティング処理手段により、複数のX線検出モジュールの境界に隣接するX線検出素子23aにより生成される第1検出データが、第1検出データを生成したX線検出素子23aの周囲にあるX線検出素子23aにより生成された第2検出データに基づく波形データと適合させるように、検出データをフィッティング処理する。

【0044】

本実施形態において、フィッティング処理手段は、第1検出データと第2検出データと を用いてフィッティング処理する。たとえば、フィッティング処理手段は、第1検出デー タと第2検出データと用いて最小二乗誤差基準で導かれる多項式で示される波形データに 適合するように、第1検出データと第2検出データとのそれぞれに重み係数を与えて、第 1検出データを正規化して、検出データをフィッティング処理する。なお、第1検出デー タと第2検出データとを用いるフィッティング処理の詳細については後述する。 【0045】

さらに、中央処理装置30は、断層画像生成手段として機能するプログラムを有し、複数のビュー方向からの検出データに基づいて画像再構成を行い、複数の断層像を生成する。ここでは、フィッティング処理された第1検出データと第2検出データとを検出データして用いる。また、中央処理装置30における画像再構成には、たとえば、フィルタード・バックプロジェクション(filtered back Projection)法が用いられる。そして、中央処理装置30は、再構成された画像を表示装置32に表示させる。

[0046]

入力装置31は、撮影条件等の情報を中央処理装置30に入力するために設けられており、たとえば、キーボードやマウスにより構成される。なお、入力装置31は、走査ガントリ2または撮影テーブル4に接続されていてもよい。

【0047】

表示装置32は、中央処理装置30からの指令に基づき、再構成されて生成された断層 像やその他の各種情報を表示する。

【0048】

記憶装置33は、各種のデータや再構成画像およびプログラム等を記憶し、記憶データ 50

が、必要に応じて中央処理装置30によりアクセスされる。

[0049]

つぎに、上記の本実施形態のX線CT装置1を用いるX線断層撮影方法について説明す る。

[0050]

図6は、本実施形態のX線検出アレイ23のうち、体軸方向zに隣接して並列するAと B との 2 つの X 線検出 モジュール 2 3 A , 2 3 B の部分が検出した X 線により生成される 検出データを示す図であり、図6(a)がフィッティング処理前を示し、図6(b)がフ ィッティング処理後を示している。図6では、2つのX線検出モジュール23A,23B において、それぞれ、チャネル方向 x に 8 個の X 線検出素子 2 3 a が並び、体軸方向 z に 4個のX線検出素子23aが並んでいる部分について示している。なお、図6(a)では 、 四 角 形 で 囲 ん だ 個 所 は 、 2 つ の X 線 検 出 モ ジ ュ ー ル 2 3 A , 2 3 B の 境 界 K に 隣 接 す る X 線検出素子 2 3 a が検出する X 線によって得られる第 1 検出データ A 4 1 ~ 4 8 , B 1 1~18を示している。

 $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 5 & 1 \end{bmatrix}$

図 7 は、本実施形態において、体軸方向に並ぶ X 線検出素子 2 3 a で得られる検出デー タをプロットした図であり、図7(a)がフィッティング処理工程前を示し、図7(b) がフィッティング処理工程後を示している。そして、図7においては、たとえば、図6に 示すように、体軸方向に並ぶ第1検出データと第2検出データとを有する検出データA1 1 , A 2 1 , A 3 1 , A 4 1 , B 1 1 , B 2 1 , B 3 1 , B 4 1 を用いている。また、図 7 において、横軸は、検出データを得た X 線検出素子 2 3 a の位置を示し、縦軸は、検出 されるX線の強度に基づいて生成された検出データのデータ値を示す。

20

50

10

[0052]

X 線 断 層 撮 影 方 法 で は 、 X 線 5 の 走 査 に 先 が け て 、 ま ず 、 オ ペ レ ー タ に よ り 入 力 装 置 3 1 を 介 し て 被 撮 影 体 6 の 撮 影 領 域 の 情 報 が 中 央 処 理 装 置 3 0 に 入 力 さ れ る 。 そ し て 、 中 央 処 理 装 置 3 0 は 、 入 力 装 置 3 1 か ら 入 力 さ れ る 情 報 に 基 づ い て 、 被 撮 影 体 6 が 載 置 さ れ る 撮影 テ ー ブ ル 4 を 走 査 ガ ン ト リ 2 の X 線 照 射 空 間 2 9 に 搬 入 ま た は 搬 出 さ せ る た め の 制 御 信 号 C T L 3 0 b を 撮 影 テ ー ブ ル 4 に 出 力 し 、 被 撮 影 体 6 の 撮 影 領 域 が 走 査 ガ ン ト リ 2 の X線照射空間29の所望の位置となるように位置決めする。また、中央処理装置30は、 制御信号 C T L 3 0 1 を X 線コントローラ 2 5 に出力して、 X 線コントローラ 2 5 に X 線 30 管 2 0 へ制 御 信 号 C T L 2 5 1 を 出 力 さ せ て 、 X 線 管 2 0 か ら の X 線 5 の 放 射 を 実 行 さ せ る。さらに、中央処理装置30は、制御信号CTL302をコリメータコントローラ26 に出力し、コリメータコントローラ26にコリメータ22のアパーチャ221の開度を制 御する制御信号CTL261をコリメータ22へ供給させる。そして、被撮影体6の撮影 領 域 を 透 過 し た X 線 は 、 X 線 検 出 素 子 2 3 a が ア レイ 状 に 配 置 さ れ て い る X 線 検 出 モ ジ ュ ー ル を 有 し 、 X 線 検 出 モ ジ ュ ー ル が 隣 接 し て 配 置 さ れ て い る X 線 検 出 ア レ イ 2 3 に よ り 検 出される。そして、X線検出アレイ23により検出されるX線5について、感度補正など の前処理をして、検出データが生成される。

[0053]

図7(a)に示すように、第1検出データと第2検出データとを含む検出データA11 40 , A 2 1 , A 3 1 , A 4 1 , B 1 1 , B 2 1 , B 3 1 , B 4 1 による波形データは、第 1 検出データA41,B11の部分で不連続となっている。この原因としては、第1検出デ ー 夕 A 4 1 , B 1 1 に 相 当 す る 部 分 が 、 複 数 の X 線 検 出 モ ジ ュ ー ル 2 3 A , 2 3 B の 境 界 K に 隣 接 す る X 線 検 出 素 子 2 3 a に よ り 検 出 さ れ た X 線 に よ り 得 ら れ る た め に 、 第 2 検 出 データ A 1 1 , A 2 1 , A 3 1 , B 2 1 , B 3 1 , B 4 1 が含むクロストーク発生量と異 なっていることにある。

そこで、X線断層撮影方法におけるフィッティング処理工程では、図7に示すように第 1 検出 データと第 2 検出 データとが 含む クロストーク 発生量 がそれ ぞれ で 異なる ことを 補 正するため、X線検出アレイ23が検出するX線により生成される検出データのうち、複 数の X 線検出モジュール 2 3 A , 2 3 B の境界に隣接する X 線検出素子 2 3 a が検出する X 線により生成される第 1 検出データが、第 1 検出データを得る X 線検出素子 2 3 a の周 囲の X 線検出素子 2 3 a が検出する放射線により生成される第 2 検出データに基づく波形 データと適合するようにして、検出データをフィッティング処理する。 【 0 0 5 5 】

ここで、本実施形態のフィッティング処理工程では、第1検出データと第2検出データ とを用いてフィッティング処理する。たとえば、第1検出データと第2検出データと用い て最小二乗誤差基準で導かれる多項式で示される波形データに適合するように、第1検出 データと第2検出データとのそれぞれに重み係数を与えて、第1検出データを正規化する 多項式フィッティング処理する。図6に示すように、一方のX線検出モジュール23Aに おける第1検出データA41については、2次3次多項式で示される波形データに適合す るために、A'41=(-2・A11+3・A21+6・A31+7・A41+6・B1 1 + 3 ・ B 2 1 - 2 ・ B 3 1) / 2 1 のように、第 1 検出 データ A 4 1 と、その第 1 検出 デ ー 夕 A 4 1 を 中 心 に 体 軸 方 向 の 周 囲 の 3 つ の X 線 検 出 素 子 に よ り 得 ら れ る 検 出 デ ー 夕 A A
A
A
A
B
A
B
A
B
A
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C のち、その加算した値を所定の正規化係数で割った値 A ' 4 1 を第 1 検出データ A 4 1 と する。他方のX線検出モジュール23Bにおける第1検出データB11についても、同様 に 処 理 す る 。 な お 、 本 実 施 形 態 の フィ ッ ティ ン グ 処 理 工 程 は 、 第 1 検 出 デ ー タ と 第 2 検 出 データとにローパスフィルタを用いてフィルタリング処理をして、第1検出データに多く 含んでいる高周波数成分を除去することと同意であり、診断目的や対象部位に応じて所望 のローパスフィルタを用いることができる。

【0056】

このようにして、図6(a)に示す第1検出データA41~48,B11~18を、図6(b)に示すよう、フィッティング処理により補正された第1検出データA'41~48,B'11~18に置換し、図7(b)に示すように、第1検出データが第2検出データに基づく波形データに適合するに補正する。

【0057】

そして、断層画像生成工程においては、フィッティング処理された検出データに基づいて、中央処理装置30により画像再構成を実施して断層画像データを生成する。そして、 表示工程においては、断層画像生成工程で生成された断層画像を表示装置32に表示させ る。

【0058】

以上のように、本実施形態は、被撮影体の撮影領域に X 線を照射し、互いが体軸方向で 隣接して配置されている複数の X 線検出モジュールにおいてアレイ状に配置されている X 線検出素子により、被撮影体の撮影領域を透過する X 線を検出する。そして、 X 線検出素 子が検出する X 線により生成される検出データのうち、複数の X 線検出モジュールの境界 に隣接する X 線検出素子で検出する X 線により生成される第 1 検出データが、その体軸方 向の周囲の X 線検出素子が検出する X 線により生成される第 2 検出データに基づく波形デ ータと適合するようにして、フィッティング処理する。

【0059】

40

10

20

30

フィッティング処理することにより、複数のX線検出モジュールの体軸方向での境界近傍のX線検出素子による第1検出データが、その周囲の第2検出データと同様に、X線検 出モジュールの体軸方向での境界の影響を受けない場合のクロストーク発生量を含むよう に補正される。つまり、クロストーク発生量の体軸方向でのプロファイルが連続的となる ように補正している。また、本実施形態は、あらかじめ求められたクロストーク発生量を 用いないで、被撮影体の撮影領域の撮影時に得られる検出データに基づいて補正している 。このため、本実施形態は、高精度に補正することができ、断層画像のコントラストの低 下やアーチファクトの発生を防止でき、再構成により生成される断層画像の画像品質を向 上することができる。 【0060】

(11)

また、本実施形態は、第1検出データと第2検出データと用いる多項式フィッティング 処理により、フィッティング処理を行っている。このように簡便な方法でフィッティング 処理を行うため、高速に撮影することができる。

(12)

【0061】 <実施形態2>

本発明の実施形態2に係る放射線断層撮影装置としてのX線CT装置は、実施形態1と 同様に、図1と図2とに示される構成を有している。本実施形態のX線CT装置は、実施 形態1とフィッティング処理手段が異なることを除き、実施形態1と同様である。このた め、実施形態1のX線CT装置と重複する個所についての説明は省略する。 【0062】

本実施形態のX線CT装置のフィッティング処理手段は、実施形態1と同様に、中央処 理装置30に設けられる。本実施形態において、フィッティング処理手段は、第2検出デ ータのみを用いるフィッティング処理により、第1検出データに対応するダミーデータを 算出し、そのダミーデータを第1検出データと置換する。

[0063]

つぎに、本実施形態のX線CT装置を用いるX線断層撮影方法について説明する。本実施形態のX線断層撮影方法は、実施形態1とフィッティング処理工程が異なることを除き、実施形態1と同様である。このため、実施形態1のX線断層撮影方法と重複する個所についての説明は省略する。

[0064]

図 8 は、本実施形態の X 線検出アレイ 2 3 のうち、体軸方向 z に隣接して並列する A と B との 2 つの X 線検出モジュール 2 3 A , 2 3 B の部分が検出した X 線により生成される 検出データを示す図であり、図 8 (a)がフィッティング処理前を示し、図 8 (b)がフ ィッティング処理後を示している。図 8 では、 2 つの X 線検出モジュール 2 3 A , 2 3 B において、それぞれ、チャネル方向 x に 8 個の X 線検出素子 2 3 a が並び、体軸方向 z に 4 個の X 線検出素子 2 3 a が並んでいる部分について示している。なお、図 8 (a)では 、四角形で囲んだ個所は、 2 つの X 線検出モジュール 2 3 A , 2 3 B の境界 K に隣接する X 線検出素子 2 3 a が検出する X 線によって得られる第 1 検出データA 4 1 ~ 4 8 , B 1 1 ~ 1 8 を示している。

【0065】

本実施形態のフィッティング処理工程は、第2検出データのみを用いるフィッティング 処理により、第1検出データに対応するダミーデータを算出し、そのダミーデータを第1 検出データと置換する。図8(a)に示すように、たとえば、第2検出データA11,A 21,A31,B21,B31,B41に対してローパスフィルタを用いてフィルタリン グ処理をして、第2検出データA11,A21,A31,B21,B31,B41に基づ く波形データを導く。図8(b)に示すように、そして、その波形データを用いて、第1 検出データA41、B11に対応するダミーデータA''41,B''11を算出し、そのダ ミーデータA''41,B''11を第1検出データA41、B11と置換することによりフ ィッティング処理する。

[0066]

以上のように、本実施形態は、第2検出データのみを用いるフィッティング処理により、第1検出データに対応するダミーデータを算出し、そのダミーデータを第1検出データ と置換する。このため、本実施形態は、実施形態1と同様に、断層画像のコントラストの 低下やアーチファクトの発生を防止でき、再構成により生成される断層画像の画像品質を 向上することができ、高速に撮影することができる。

【0067】

< 実施形態 3 >

本発明の実施形態3に係る放射線断層撮影装置としてのX線CT装置は、実施形態1および2と同様に、図1と図2とに示される構成を有している。本実施形態のX線CT装置は、実施形態1および2とフィッティング処理手段が異なることを除き、実施形態1およ

10

20



び 2 と同様である。このため、実施形態 1 および 2 の X 線 C T 装置と重複する個所につい ての説明は省略する。

【0068】

本実施形態のX線CT装置のフィッティング処理手段は、実施形態1および2と同様に 、中央処理装置30に設けられる。本実施形態において、フィッティング処理手段は、第 2検出データを用いるフィッティング処理により第1検出データに対応する第1ダミーデ ータを複数のX線検出モジュールのそれぞれで算出し、第1ダミーデータと第1検出デー タとの差分データを複数のX線検出モジュールのそれぞれで算出する。また、差分データ の平均値データを複数のX線検出モジュールのそれぞれで算出し、第1データと差分平均 値データとの差分である第2ダミーデータを複数のX線検出モジュールのそれぞれで算出 する。その後、複数のX線検出モジュールのそれぞれに対応する第1検出データを第2ダ ミーデータに置換する。

【0069】

つぎに、本実施形態のX線CT装置を用いるX線断層撮影方法について説明する。本実施形態のX線断層撮影方法は、実施形態1および2とフィッティング処理工程が異なることを除き、実施形態1および2と同様である。このため、実施形態1および2のX線断層撮影方法と重複する個所についての説明は省略する。

【 0 0 7 0 】

図9は、本実施形態のX線検出アレイ23のうち、体軸方向zに隣接して並列するAと Bとの2つのX線検出モジュール23A,23Bの部分が検出したX線により生成される 検出データを示す図であり、図9(a)がフィッティング処理前を示し、図9(b)がフ ィッティング処理後を示している。図9では、2つのX線検出モジュール23A,23B において、それぞれ、チャネル方向xに8個のX線検出素子23aが並び、体軸方向zに 4個のX線検出素子23aが並んでいる部分について示している。なお、図9(a)では 、四角形で囲んだ個所は、2つのX線検出モジュール23A,23Bの境界Kに隣接する X線検出素子23aが検出するX線によって得られる第1検出データA41~48,B1 1~18を示している。

[0071]

本実施形態のフィッティング処理工程は、第2検出データを用いるフィッティング処理 により第1検出データに対応する第1ダミーデータを複数のX線検出モジュールのそれぞ れで算出し、第1ダミーデータと第1検出データとの差分データを複数のX線検出モジュ ールのそれぞれで算出する。また、差分データの平均値データを複数のX線検出モジュー ルのそれぞれで算出し、第1データと差分平均値データとの差分である第2ダミーデータ を複数のX線検出モジュールのそれぞれで算出する。その後、複数のX線検出モジュール のそれぞれに対応する第1検出データを第2ダミーデータに置換する。 【0072】

図9に示すように、たとえば、第2検出データA11,A21,A31,B21,B3 1,B41に対してローパスフィルタを用いてフィルタリング処理をして、その後、フィ ルタリング処理した第2検出データA11,A21,A31,B21,B31,B41に 基づく波形データを導く。そして、その波形データを用いて、A列のX線検出モジュール 23Aの第1検出データA41と、B列のX線検出モジュール23Bの第1検出データB 11に対応する第1ダミーデータA''41,B''11をそれぞれ算出する。 【0073】

その後、第1ダミーデータA''41,B''11と第1検出データA41,B11との差 分データAE41,BE11を算出する。この差分データA41,B11は、X線検出モ ジュール23A,23Bの体軸方向での境界Kの影響を受けない場合のクロストーク発生 量に略相当する。以上の工程は、X線検出モジュール23A,23BのそれぞれのX線検 出素子23aごと実施して、チャネル方向×に並ぶ第1検出データA41~48と、その 第1検出データA41~48,B11~B18との差分データAE41~48,BE11~18を算出する。 10

20

[0074]

そして、 A 列の X 線検出モジュール 2 3 A の 複数の差分データ A E 4 1 ~ 4 8 を用いて 、 A 列の X 線検出モジュール 2 3 A の差分平均値データ A A E を算出し、 B 列の X 線検出 モジュール 2 3 B の 複数の差分データ A E 4 1 ~ 4 8 , B E 1 1 ~ 1 8 を用いて、 B 列の X 線検出モジュール 2 3 B の差分平均値データ A B E を算出する。 【 0 0 7 5 】

(14)

そして、第1検出データA41~48, B11~18と差分平均値データAAE, AB Eとの差分である第2ダミーデータA'''41~48, B'''11~18を、AとBとのX 線検出モジュール23A, 23Bのそれぞれで算出する。

【0076】

10

その後、図9(b)にしめすように、AとBとのX線検出モジュール23A,23Bの それぞれに対応する第1検出データA41~48,B11~18を、それぞれに対応する 第2ダミーデータA'''41~48,B'''11~18と置換する。 【0077】

以上のように、本実施形態は、複数のX線検出モジュールの体軸方向での境界の影響を 受けない場合のクロストーク発生量に略相当する差分データについて平均値をとって差分 平均値データを求め、その差分平均値データを用いる。このため、この差分データにノイ ズ成分が含まれている場合であっても、複数のX線検出モジュールの体軸方向での境界近 傍のX線検出素子による第1検出データが、その周囲の第2検出データと同様に、X線検 出モジュールの体軸方向での境界の影響を受けない場合のクロストーク発生量を含むよう に補正される。したがって、実施形態1と同様に、断層画像のコントラストの低下やアー チファクトの発生を防止して断層画像の画像品質を向上できる。

[0078]

なお、本発明の実施に際しては、上記した実施の形態に限定されるものではなく、種々 の変形形態を採用することができる。

[0079]

たとえば、上記実施形態では、複数のX線検出モジュールの体軸方向での境界近傍における検出データについて、フィッティング処理しているが、複数のX線検出モジュールの チャネル方向での境界近傍における検出データについても適用可能である。

【0080】

また、たとえば、上記実施形態では、第1検出データとして放射線検出モジュールの境 界に最も隣接する放射線検出素子である第1放射線検出素子からの検出データを用い、第 2検出データとして、第1放射線検出素子の体軸方向にそれぞれ3つ並んでいる周囲の放 射線検出素子である第2放射線検出素子からの検出データを用いているが、第1検出デー タおよび第2検出データともに、検出データ全体の波形データに基づいて任意の数の検出 データを用いてもよい。

【図面の簡単な説明】

[0081]

【図1】図1は、本発明の実施形態1に係る放射線断層撮影装置としてのX線CT装置の 全体構成を示すブロック図である。

【図2】図2は、本発明の実施形態1に係る放射線断層撮影装置としてのX線CT装置の 要部を示す構成図である。

【図3】図3は、本発明の実施形態1に係る放射線断層撮影装置としてのX線CT装置に おけるX線検出モジュールの構成図である。

【図4】図4は、本発明の実施形態1に係る放射線断層撮影装置としてのX線CT装置に おいて、X線管とコリメータとX線検出アレイの相互関係を示す図であり、図4(a)は 体軸方向を視線とした側から見た状態を示す図であり、図4(b)はチャネル方向を視線 として側から見た状態を示している。

【 図 5 】 図 5 は、本発明の実施形態 1 に係る放射線断層撮影装置としての X 線 C T 装置に おいて、 X 線管とコリメータと X 線検出アレイの相互関係を示す図であり、チャネル方向

30

20

を視線として側から見た状態にて被撮影体を撮影する様子を示している。 【図6】図6は、本発明の実施形態1に係る放射線断層撮影装置としてのX線CT装置において、X線検出アレイの複数のX線検出モジュールのうち、体軸方向に隣接して並列するAとBとの2つのX線検出モジュールの部分が検出したX線により生成される検出データを示す図である。

【図7】図7は、本発明の実施形態1に係る放射線断層撮影装置としてのX線CT装置に おいて、体軸方向に並ぶX線検出素子で得られる検出データをプロットした図である。 【図8】図8は、本発明の実施形態2に係る放射線断層撮影装置としてのX線CT装置に おいて、X線検出アレイの複数のX線検出モジュールのうち、体軸方向に隣接して並列す るAとBとの2つのX線検出モジュールの部分が検出したX線により生成される検出デー タを示す図である。

【図9】図9は、本発明の実施形態3に係る放射線断層撮影装置としてのX線CT装置に おいて、X線検出アレイの複数のX線検出モジュールのうち、体軸方向に隣接して並列す るAとBとの2つのX線検出モジュールの部分が検出したX線により生成される検出デー タを示す図である。

【符号の説明】

[0082]

1 … X 線 C T 装置、2 … 走査ガントリ、3 … 操作コンソール、4 … 撮影テーブル、5 … X 線、6 … 被撮影体、2 0 … X 線管、2 1 … X 線管移動部、2 2 … コリメータ、2 3 … X 線 検出アレイ、2 4 … データ収集部、2 4 1 … 選択・加算切換回路、2 4 2 … アナログ - デ ジタル変換器、2 5 … X 線コントローラ、2 6 … コリメータコントローラ、2 7 … 回転部 、2 8 … 回転コントローラ、2 9 … X 線照射空間、3 0 … 中央処理装置、3 1 … 入力装置 、3 2 … 表示装置、3 3 …記憶装置

【図1】





10

【図3】

【図4】







【図5】



【図6】 (a)

A11 A21 A31 A41 B11 B21 B31 B4 A12 A22 A32 A42 B12 B22 B32 B4 A13 A23 A33 A43 B13 B23 B33 B4 A13 A23 A33 A43 B13 B23 B33 B4 A14 A24 A34 A44 B14 B24 B34 B4 A14 A24 A34 A44 B14 B24 B34 B4 A15 A25 A35 A45 B15 B25 B35 B4 A16 A26 A36 A46 B16 B26 B36 B4 A17 A27 A37 A47 B17 B27 B37 B4 A18 A28 A38 A48 B18 B28 B38 B4		23	A	K	23B				
A11 A21 A31 A41 B11 B21 B21 B31 B44 A12 A22 A32 A42 B12 B22 B32 B44 A12 A22 A32 A42 B13 B22 B32 B44 A13 A23 A33 A43 B13 B23 B33 B44 A14 A24 A34 A44 B14 B24 B34 B4 A14 A24 A34 A44 B14 B24 B34 B4 A15 A25 A35 A45 B15 B25 B35 B4 A16 A26 A36 A46 B16 B26 B36 B4 A17 A27 A37 A47 B17 B27 B37 B4 A18 A28 A38 A48 B18 B28 B38 B44	A1	A 2	A3	A4	в1	B2	B 3	B4	
A11 A21 A31 A41 B11 B21 B31 B44 A12 A22 A32 A42 B12 B22 B32 B44 A12 A22 A32 A42 B12 B22 B32 B44 A13 A23 A33 A43 B13 B23 B33 B44 A14 A24 A34 A44 B14 B24 B34 B44 A15 A25 A35 A45 B15 B25 B35 B44 A16 A26 A36 A46 B16 B26 B36 B44 A17 A27 A37 A47 B17 B27 B37 B44	A18	A28	A38	A48	B18	B28	B38	B48	
A11 A21 A31 A41 B11 B21 B31 B44 A12 A22 A32 A42 B12 B22 B32 B44 A13 A23 A33 A43 B13 B23 B33 B44 A14 A24 A33 A43 B13 B23 B33 B44 A14 A24 A34 A44 B14 B24 B34 B4 A14 A24 A34 A44 B14 B24 B34 B4 A15 A25 A35 A45 B15 B25 B35 B44 A16 A26 A36 A46 B16 B26 B36 B44	A17	A27	A37	A47	B17	B27	B37	B47	
A11 A21 A31 A41 B11 B21 B31 B44 A12 A22 A32 A42 B12 B22 B32 B44 A13 A23 A33 A43 B13 B23 B33 B44 A13 A23 A33 A43 B13 B23 B33 B44 A14 A24 A34 A44 B14 B24 B34 B44 A14 A24 A34 A44 B14 B24 B34 B44 A15 A25 A35 A45 B15 B25 B35 B44	A16	A26	A36	A46	B16	B26	B36	B46	
A11 A21 A31 A41 B11 B21 B31 B44 A12 A22 A32 A42 B12 B22 B32 B44 A13 A23 A33 A43 B13 B23 B33 B44 A14 A24 A33 A43 B13 B23 B33 B44 A14 A24 A34 A44 B14 B24 B34 B44	A15	A25	A35	A45	B15	B25	B35	B45	
A11 A21 A31 A41 B11 B21 B31 B44 A12 A22 A32 A42 B12 B22 B32 B44 A13 A23 A33 A43 B13 B23 B33 B44	A14	A24	A34	A44	B14	B24	B34	B44	
A11 A21 A31 A41 B11 B21 B31 B4 A12 A22 A32 A42 B12 B22 B32 B4	A13	A23	A33	A43	B13	B23	B33	B43	
A11 A21 A31 A41 B11 B21 B31 B4	A12	A22	A32	A42	B12	B22	B32	B42	
	A11	A21	A31	A41	B11	B21	B31	B41	

	23	A	ĸ		2	3В	
A 1	A 2	A3	A4 4	B1	B2	B 3	B4
A18	A28	A38	A'48	B'18	B28	B38	B48
A17	A27	A37	A'47	B'17	B27	B37	B47
A16	A26	A36	A'46	B'16	B26	B36	B46
A15	A25	A35	A'45	B'15	B25	B35	B45
A14	A24	A34	A'44	B'14	B24	B34	B44
A13	A23	A33	A'43	B'13	B23	B33	B43
A12	A22	A32	A'42	B'12	B22	B32	B42
A11	A21	A31	A'41	B'11	B21	B31	B41
(Ь)						_	

A16 A26 A36

A1

A2 A3

23A

A17 A27 A37 A18 A28 A38 A''48 B''18 B28





A''46 B''16 B26

A''47 B''17 B27

A4 🛉 B1

ĸ

B46

B36

B37 B47

B38 B48

B2 **B**3 B4

23B



データ値 (ь) z A41 B11

【図9】

	23	A			2	3В		
A1	A 2	A3	A4 (В1	B2	вз	B4	
18	A28	A38	A48	B18	B28	B38	B48	
17	A27	A37	A47	B17	B27	B37	B47	
16	A26	A36	A46	B16	B26	B36	B46	
15	A25	A35	A45	B15	B25	B35	B45	
14	A24	A34	A44	B14	B24	B34	B44	•
13	A23	A33	A43	B13	B23	B33	B43	
12	A22	A32	A42	B12	B22	B32	B42	
11	A21	A31	A41	B11	B21	B31	B41	
a)								

		222			2	38	
A1	A2	A3	A4	B1	B2	В3	B4
A18	A28	A38	A'''48	B'''18	B28	B38	B48
A17	A27	A37	A'''47	B'''17	B27	B37	B47
A16	A26	A36	A'''46	B'''16	B26	B36	B40
A15	A25	A35	A'''45	B'''15	B25	B35	B45
A14	A24	A34	A'''44	B'''14	B24	B34	B44
A13	A23	A33	A'''43	B'''13	B23	B33	B43
A12	A22	A32	A'''42	B'''12	B22	B32	B42
A11	A21	A31	A'''41	B'''11	B21	B31	B41
(Ь)							

フロントページの続き

 (72)発明者 貫井 正健 東京都日野市旭が丘四丁目7番地の127 ジーイー横河メディカルシステム株式会社内
Fターム(参考) 2G088 EE01 FF02 GG01 GG21 JJ03 JJ05 KK21 KK32 LL11 LL26 4C093 AA22 BA07 CA04 CA13 EB17 FC11 FD07 FD13 FD20 5C024 AX11 DX04